7/19/1 DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2006 Thomson Derwent. All rts. reserv.

016388200 **Image available**
WPI Acc No: 2004-546109/200453
XRPX Acc No: N04-431739

Hygienic protection for aeronautical mask comprises flexible lip for positioning mask on face and protection film, insulating skin from lip, having zone placed outside lip having structural part sealing lip and film

Patent Assignee: SCHEGERIN R (SCHE-I)

Inventor: SCHEGERIN R

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week FR 2850288 A1 20040730 FR 20031024 A 20030129 200453 B

Priority Applications (No Type Date): FR 20031024 A 20030129

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

FR 2850288 A1 11 A62B-018/02

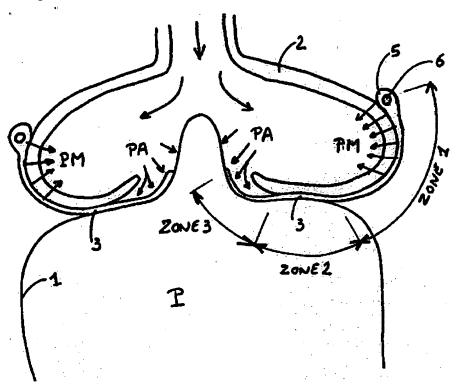
Abstract (Basic): FR 2850288 A1

NOVELTY - The facial mask which encloses the mouth and nose of the wearer (P) comprises a rigid shell held by fasteners on the wearer's face, an air inlet pipe and a flexible lip (2) for positioning the mask on the user's face. A thin elastic hygienic protection film (3) insulates the wearer's skin (1) from the lip. The film comprises a zone (1) placed outside the lip and having a structural part (5) ensuring sealing between the lip and the film. It has a zone (2) placed over all the outer part of the lip and a zone (3) which, under the effect of air pressure (PA) inside the mask is plated against the wearer's skin

USE - Hygienic protection for aeronautical mask.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - Drawing shows the mask hygienic protection.

wearer's skin (1)
flexible lip (2)
hygienic protection film (3)
structural part (5)
wearer (P)
air pressure. (PA)
pp; 11 DwgNo 1/1



Title Terms: HYGIENE; PROTECT; AERONAUTIC; MASK; COMPRISE; FLEXIBLE; LIP; POSITION; MASK; FACE; PROTECT; FILM; INSULATE; SKIN; LIP; ZONE; PLACE; LIP; STRUCTURE; PART; SEAL; LIP; FILM

Derwent Class: P34; P35

International Patent Class (Main): A62B-018/02

International Patent Class (Additional): A61M-016/06

File Segment: EngPI

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2006 Thomson Derwent. All rights reserved.

© 2006 Dialog, a Thomson business

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11 Nº de publication :

2 850 288

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

②1 Nº d'enregistrement national :

03 01024

(51) Int CI7: A 62 B 18/02, A 61 M 16/06

12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- (22) Date de dépôt : 29.01.03.
- 30) Priorité :

71 Demandeur(s): SCHEGERIN ROBERT — FR.

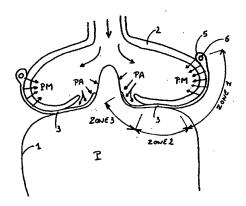
(72) Inventeur(s): SCHEGERIN ROBERT.

- Date de mise à la disposition du public de la demande : 30.07.04 Bulletin 04/31.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- 73) Titulaire(s) :
- (74) Mandataire(s) :

PROTECTION HYGIENIQUE AMELIRANT L'ETANCHEITE D'UN MASQUE DE PROTECTION AERONAUTIQUE.

Masque facial de protection physiologique englobant au moins la bouche et le nez d'un porteur (P) comprenant au moins une coquille rigide, des attaches maintenant cette coquille rigide sur la face du porteur, un conduit d'amené d'air (ou de gaz respirable), au moins une lèvre mi-souple (2) permettant le positionnement relatif du masque sur le visage du porteur (P), caractérisé par la présence, d'un film élastique et mince de protection hygiénique (3), isolant la peau (1) du porteur (P), de la lèvre mi-souple (2), ce film élastique et mince de protection hygiénique (3) comprenant trois zones principales: la zone 1, la zone 2 et la zone 3 telles que: la zone 1 soit placée à l'extérieur de la lèvre demisouple (2) et comprenant une partie structurale (5) assurant l'étanchéité entre la lèvre mi-souple (2) et le film élastique et mince de protection hygiénique (3), la zone 2 soit placée sur toute la partie extérieure de la lèvre mi-souple (2) qui aurait été en contact avec la peau (1) du porteur (P) si ce film mince de protection hygiénique (3) n'existait pas, La zone 3 qui sous l'effet de la pression (PA) de l'air (ou gaz respirable) interne au masque soit plaquée sur la peau du porteur assurant l'étanchéité entre le film élastique et mince de protection hygiénique (3) et la peau (1) du porteur P, la dite partie structurale (5) assurant une pression mécanique PM appliquée sur l'extérieur de la lèvre mi-souple (2), cette pression

mécanique (PM) étant supérieure à la pression maximale relative (PA) régnant à l'intérieur du masque, cette dite pression (PM) étant toutefois suffisamment faible pour ne pas déformer de façon significative la lèvre mi-souple (2) du masque facial de protection physiologique.





Protection hygiénique améliorant l'étanchéité d'un masque de protection aéronautique

5

Certains masques, de part leur nature et leur emploi, peuvent être utilisés par plusieurs porteurs, comme les pilotes d'avions civils par exemple. Il est très difficile dans ces conditions de garantir une hygiène satisfaisante.

10

15

D'autre part, les performances d'étanchéité des masques de protection respiratoires dans les avions modernes sont de plus en plus difficile à atteindre. Les performances d'étanchéité sont nécessaires pour garantir le maintien en condition opérationnelle de nos pilotes tout évitant le gaspillage des ressources disponibles en oxygène.

L'invention présentée ici permet d'améliorer notablement le niveau d'hygiène des masques respiratoires tout en améliorant notablement les performances d'étanchéité, requises du masque.

20

Ils existe un grand nombre de brevets décrivant des concepts présentant différentes conceptions et architectures de lèvres de masque. Un grand nombre de brevets décrivent des doubles ou même triples lèvres pour améliorer l'étanchéité des masques.

25

30

Le brevet français N° FR2657264 déposé par la société "Ulmer" le 25 janvier 1990 propose un masque inhalateur caractérisé en ce qu'il comporte à sa périphérie une enceinte gonflable et déformable. Ce concept est lourd et compliqué. Le gonflage de la lèvre crée, d'autre part, une rigidité structurale dans l'espace à trois dimensions de la lèvre et engendre des fuites importantes. Cette architecture ne permet pas une hygiène acceptable.

35

Le brevet WO9804310 déposé par la société Resmed Limited le 26 juillet 1996 présente une solution de type double lèvre intégrée. Il n'est pas fait mention d'une lèvre additionnelle pouvant être maintenu en position pendant l'utilisation du masque tout en étant facilement remplaçable à chaque opération par le pilote, améliorant à la fois l'hygiène et les performances d'étanchéité comme il est exposé dans la présente invention.

Le brevet français N° 0200140 permet l'amélioration de l'étanchéité des masques en proposant une architecture particulière de lèvre. Cette architecture ne permet pas une hygiène satisfaisante.

Le brevet français N° 0104670 décrit une architecture particulière de masque permettant un très haut niveau d'étanchéité, par la présence d'une lèvre supplémentaire interne dépassant du distance d (égale au moins à un millimètre) la lèvre principale (voir figure 3). Cette disposition ne permet pas de garantir une hygiène satisfaisante.

10

Le brevet français N° 03 00419 décrit une lèvre additionnelle comportant une partie interne à la lèvre principale du masque améliorant l'hygiène du masque mais ne permet pas d'améliorer également les performances d'étanchéité du masque.

15

La présente invention permet de garantir un très haut degré d'hygiène, tout en améliorant notablement les caractéristiques d'étanchéité des masques existants, et ceci pour un coût acceptable.

La présente invention vise à fournir un masque facial de protection physiologique englobant au moins la bouche et le nez d'un porteur (P) assurant un très haut degré d'hygiène, en assurant le non contact de la lèvre avec la peau du porteur par interposition d'un film fin entre la peau du porteur et la lèvre et en assurant également un très haut niveau de performance d'étanchéité du masque.

25

30

En effet les fuites de masques sont initiées aux endroits où il n'y a pas contact entre la peau du porteur et l'extrémité de la lèvre. Ceci est dû au fait que des efforts de tensions longitudinales le long de l'extrémité de la lèvre induisent des efforts et donc des mouvements de l'extrémité de la lèvre éloignant cette extrémité de lèvre de la peau du porteur. Ceci est surtout vrai aux endroits où la forme de la lèvre est fortement tridimensionnelle comme au niveau de la base du nez par exemple.

Ces buts sont atteints par un moyen suivant l'invention comprenant

35

- au moins une coquille rigide,
- des attaches maintenant cette coquille rigide sur la face du porteur,
- un conduit d'amené de gaz respirable

au moins une lèvre mi-souple (2) permettant le positionnement relatif du masque sur le visage du porteur (P),

qui est essentiellement caractérisé par la présence

5 d'un film élastique et mince de protection hygiénique (3), isolant la peau (1) du porteur (P), de la lèvre mi-souple (2), ce film élastique et mince de protection hygiénique (3) comprenant trois zones principales: la zone 1, la zone 2 et la zone 3 telles que: 10 - la zone 1 soit placée à l'extérieur de la lèvre demi-souple (2) et comprenant une partie structurale (5) assurant l'étanchéité entre la lèvre mi-souple (2) et le film élastique et mince de protection hygiénique (3), - la zone 2 soit placée sur toute la partie extérieure de la 15 lèvre mi-souple (2) qui aurait été en contact avec la peau (1) du porteur (P) si ce film mince de protection hygiénique (3) n'existait pas, - La zone 3 qui sous l'effet de la pression (PA) de l'air (ou gaz respirable) interne au masque soit plaquée sur la peau 20 du porteur assurant l'étanchéité entre le film élastique et mince de protection hygiénique (3) et la peau (1) du porteur P, la dite partie structurale (5) assurant une pression mécanique PM appliquée sur l'extérieur de la lèvre mi-souple (2), cette pression 25 mécanique (PM) étant supérieure à la pression maximale relative (PA) régnant à l'intérieur du masque, cette dite pression (PM) étant toutefois suffisamment faible pour ne pas déformer de façon significative la lèvre mi-souple (2) du

Il est avantageux que le dit film mince de protection hygiénique (3) située en zone 1 soit constituée par le film lui même assurant par élasticité propre la pression (PM) nécessaire pour assurer l'étanchéité requise.

masque facial de protection physiologique.

30

35 Il est avantageux que la dite partie structurale (5) comporte un fil élastique (6).

Il est avantageux que le dit film mince de protection hygiénique (3) soit aisément remplaçable par le porteur (P) après chaque usage.

Il est avantageux que le dit film mince de protection hygiénique (3) soit stocké dans un emballage étanche et stérile.

Il est avantageux que le dit film mince de protection hygiénique (3) émette une odeur agréable.

Il est avantageux que le dit film mince de protection hygiénique (3) ait une texture agréable au toucher

10 Il est avantageux que le dit film mince de protection hygiénique (3) ait une couleur agréable.

L'invention sera mieux comprise par la description détaillée d'un mode de réalisation illustrée sur les dessins annexés qui représentent:

- FIGURE 1 : une coupe sensiblement horizontale au niveau du nez d'un porteur de la lèvre comportant le film de protection hygiénique
- Sur la figure 1, est représentée une coupe partielle horizontale de la lèvre misouple (2). On peut voir le film de protection hygiénique (3) et les trois zones:

25

30

35

- la zone 1 placée à l'extérieur de la lèvre demi-souple (2) et comprenant une partie structurale (5) assurant l'étanchéité entre la lèvre mi-souple (2) et le film élastique et mince de protection hygiénique (3),
- la zone 2 placée sur toute la partie extérieure de la lèvre mi-souple
 (2) qui aurait été en contact avec la peau (1) du porteur (P) si ce film mince de protection hygiénique (3) n'existait pas,
- La zone 3 qui sous l'effet de la pression (PA) de l'air (ou gaz respirable) interne au masque est plaquée sur la peau du porteur assurant l'étanchéité entre le film élastique et mince de protection hygiénique (3) et la peau (1) du porteur P.

La description détaillée d'un mode de réalisation qui suit correspond à la figure 1.

Une lèvre de type classique (2) est placée dans une coquille permettant son maintien et son attache sur la tête du porteur. Cette lèvre est semi-souple et permet le positionnement et une certaine étanchéité du masque de protection respiratoire. Afin d'assurer un niveau d'hygiène satisfaisant, un film fin (3) est 5 placé à l'extérieur de la lèvre. Ce film fin entoure tout l'extérieur de la lèvre du masque. L'élasticité propre de ce film fin permet de le placer aisément sur le pourtour de la lèvre du masque. Cette zone est appelée zone 1. Elle peut être renforcée par une structure composée par un fil élastique intégré au dit film fin. Cette disposition particulière permet de remplacer le film fin aisément et plaque 10 fermement le film fin sur l'extérieur de la lèvre du masque en créant une pression PM assurant l'étanchéité entre le film fin (3) et la lèvre (2). Les caractéristiques élastiques de l'ensemble film fin (3) et structure (5) sont choisies pour que la pression PM exercée soit supérieure à la pression relative PA de l'air contenu dans le masque respiratoire sans toutefois être trop importante pour ne 15 pas déformer notablement la lèvre (2) du masque respiratoire. Au niveau de la zone 2 le film fin est placé entre la peau et la lèvre du masque et permet ainsi une protection hygiénique. Au niveau de la zone 3 le film fin est dans cette zone très souple et permet de suivre la peau dans ses moindres recoins et ainsi d'assurer l'étanchéité entre la 20 peau et le film fin. La continuité de ce film fin permet donc d'assurer une performance d'étanchéité nettement supérieure aux masques classiques.

Les applications de cette invention sont nombreuses. Cette invention trouve des applications tout à fait intéressantes dans la réalisation de systèmes de protection respiratoire où les critères d'hygiène et d'étanchéité sont primordiaux comme dans les applications aéronautiques civiles et militaires.

REVENDICATIONS

5 1- Masque facial de protection physiologique englobant au moins la bouche et le nez d'un porteur (P) comprenant au moins une coquille rigide, des attaches maintenant cette coquille rigide sur la face du porteur, 10 un conduit d'amené d'air (ou de gaz respirable) au moins une lèvre mi-souple (2) permettant le positionnement relatif du masque sur le visage du porteur (P), 15 caractérisé par la présence d'un film élastique et mince de protection hygiénique (3), isolant la peau (1) du porteur (P), de la lèvre mi-souple (2), ce film élastique et mince de protection hygiénique (3) comprenant trois zones principales: la zone 1, la zone 2 et la zone 3 telles que: 20 - la zone 1 soit placée à l'extérieur de la lèvre demi-souple (2) et comprenant une partie structurale (5) assurant l'étanchéité entre la lèvre mi-souple (2) et le film élastique et mince de protection hygiénique (3), 25 - la zone 2 soit placée sur toute la partie extérieure de la lèvre mi-souple (2) qui aurait été en contact avec la peau (1) du porteur (P) si ce film mince de protection hygiénique (3) n'existait pas, - la zone 3 qui sous l'effet de la pression (PA) de l'air (ou gaz respirable) interne au masque soit plaquée sur la peau 30 du porteur assurant l'étanchéité entre le film élastique et mince de protection hygiénique (3) et la peau (1) du porteur P, la dite partie structurale (5) assurant une pression mécanique PM 35 appliquée sur l'extérieur de la lèvre mi-souple (2), cette pression mécanique (PM) étant supérieure à la pression maximale relative (PA) régnant à l'intérieur du masque,

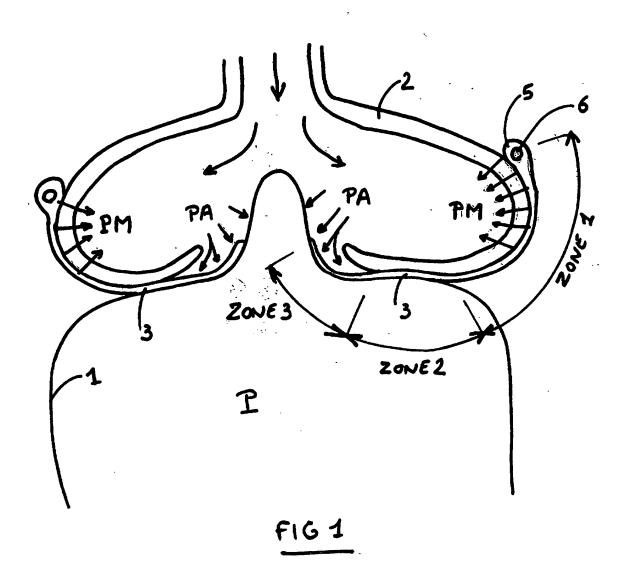
- cette dite pression (PM) étant toutefois suffisamment faible pour ne pas déformer de façon significative la lèvre mi-souple (2) du masque facial de protection physiologique.
- Masque facial de protection physiologique suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la dite partie structurale (5) du film mince de protection hygiénique (3) située en zone 1 soit constituée par le film lui même assurant par élasticité propre la pression (PM) nécessaire pour assurer l'étanchéité requise.

15

20

- 3- Masque facial de protection physiologique suivant une des revendications
 1 à 2, caractérisé en ce que la dite partie structurale (5) comporte un fil élastique (6).
- 4- Masque facial de protection physiologique suivant une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ce dit film mince de protection hygiénique (3) soit aisément remplaçable par le porteur (P) après chaque usage.
- 5- Masque facial de protection physiologique suivant une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le dit film mince de protection hygiénique (3) soit stocké dans un emballage étanche et stérile.

1/1





RAPPORT DE RECHERCHE **PRÉLIMINAIRE**

N° d'enregistrement national

FA 634710 FR 0301024

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

DOCL	IMENTS CONSIDÉRÉS COMME I	Revendication(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI	
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de des parties pertinentes	besoin,		2 mironaoir par 1 mir
Y,D	FR 2 823 122 A (SCHEGERIN RO 11 octobre 2002 (2002-10-11) * le document en entier *	1-5	A62B18/02 A61M16/06	
Y,D	US 6 112 746 A (KWOK PHILIP 5 septembre 2000 (2000-09-09 * le document en entier *		1-5	
Α	US 4 971 051 A (TOFFOLON NOI 20 novembre 1990 (1990-11-20 * colonne 3, ligne 2 - ligne *	9)	1-5	
Α	US 2002/134388 A1 (CHANG TI- 26 septembre 2002 (2002-09-2 * le document en entier *		1	
Α	FR 2 682 043 A (INTERTECHNIC 9 avril 1993 (1993-04-09) * le document en entier *	QUE SA)	1	DOMAINES TECHNIQUES
A	US 5 003 633 A (ITOH AKIRA) 2 avril 1991 (1991-04-02)			A61M A62B
A	DE 390 903 C (VERWERTUNG CHIPRODUKTE) 6 juin 1924 (1924-			
<u>.</u>	Date d'ac	hèvement de la recherche		Examinateur
	12	2 décembre 2003	Tri	antaphillou, P
X : part Y : part autro A : arric	ATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS iculièrement pertinent à lui seul iculièrement pertinent en combinaison avec un e document de la même catégorie ere-plan technologique lgation non-éorite	de dépôt ou qu'à : D : cité dans la dema L : cité pour d'autres	vet bénéficiant d'u : et qui n'a été pub une date postérieu unde raisons	ine date antérieure ilié qu'à cette date

EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)

1

- O : divulgation non-écrite P : document intercalaire

&: membre de la même famille, document correspondant

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0301024 FA 634710

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

recretore preliminaire vise ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 12-12-2003

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

A A	11-10-2002	FR	2823122	A1	11-10-2002
Α	05 00 0000				11 10 2002
	05-09-2000	ΑŲ	1245497	Α	05-02-1998
		ΑU	710733	B2	30-09-1999
		ΑU	3429397	Α	20-02-1998
		WO	9804310	A1	05-02-1998
		CA	2261790	A1	05-02-1998
		DE	29724224	U1	07-09-2000
		EΡ			17-11-1999
		JP			28-11-2000
					08-08-2002
					04-07-2002
					20-06-2002
					28-11-2002
					14-03-2002
					17-01-2002
		US	2002005200	A1	17-01-2002
Α	20-11-1990	AUCU	N		
A1	26-09-2002	AUCU	N		
Α	09-04-1993	FR	2682043	A1	09-04-1993
		DE	4233448	A1	08-04-1993
					07-04-1993
		US	5349949	Α	27-09-1994
Α	02-04-1991	JР	2700490	B2	21-01-1998
		JР			14-01-1991
		DE	3935890	A1	06-12-1990
С	06-06-1924	AUCU	N		
	A1 A	A1 26-09-2002 A 09-04-1993 A 02-04-1991	A 09-04-1993 FR DE GB US A 02-04-1991 JP JP DE	EP 0956069 JP 2000515784 US 2002104540 US 2002083948 US 2002074001 US 2002027401 US 2002029781 US 2002005198 US 2002005200 A 20-11-1990 AUCUN A1 26-09-2002 AUCUN A 09-04-1993 FR 2682043 DE 4233448 GB 2260084 US 5349949 A 02-04-1991 JP 2700490 JP 3007173 DE 3935890	EP 0956069 A1 JP 2000515784 T US 2002104540 A1 US 2002083948 A1 US 2002074001 A1 US 2002074868 A1 US 2002029781 A1 US 2002005198 A1 US 2002005200 A1 A 20-11-1990 AUCUN A1 26-09-2002 AUCUN A 09-04-1993 FR 2682043 A1 DE 4233448 A1 GB 2260084 A B US 5349949 A A 02-04-1991 JP 2700490 B2 JP 3007173 A DE 3935890 A1